

Porte-Wafer Ptfé Pour Semi-Conducteurs 8 Pouces, Nettoyage Humide Résistant À Hf, Cassette De Gravure

Numéro d'article: PL-CP82



Introduction

Optimisez le traitement des semi-conducteurs avec ce porte-wafer PTFE premium de 8 pouces, conçu pour le nettoyage humide de haute pureté et les applications de gravure HF. Nos cassettes en fluoropolymère de qualité industrielle garantissent une résistance chimique maximale, une durabilité supérieure et une manipulation précise pour les environnements de production en salle blanche sensibles.

[En savoir plus](#)

| Application | Description | Avantage clé |
|----------------------------------|---|--|
| Gravure de wafer de silicium | Manipulation des wafers lors du retrait des couches sacrificielles en utilisant des chimies à base de HF. | Une résistance complète aux attaques acides assure la longévité du porte-wafer. |
| Procédé de nettoyage RCA | Support des wafers à travers plusieurs étapes d'élimination de contaminants organiques et ioniques. | La pureté du matériau empêche la recontamination des surfaces nettoyées. |
| Post-nettoyage CMP | Transport des wafers à travers les brosses de nettoyage et les bains chimiques après la planarisation. | Le faible dégagement de particules maintient des comptes de défauts extrêmement bas. |
| Décapage de résine photosensible | Utilisation de solvants agressifs pour éliminer les revêtements sensibles à la lumière après la lithographie. | L'inertie chimique empêche la dégradation du matériau dans les bains de solvant. |
| Fabrication de cellules solaires | Support du traitement de substrats à grande échelle dans des environnements très acides pour les cellules PV. | La durabilité dans la production à grand volume réduit les coûts de remplacement. |
| Fabrication MEMS | Gestion des systèmes micro-électromécaniques délicats lors des étapes complexes de libération humide. | L'alignement précis des fentes empêche les dommages mécaniques aux structures. |
| Échantillonnage analytique | Utilisation du porte-wafer comme support de substrat pour l'analyse de métaux traces de haute pureté. | Les niveaux de fond ultra-faibles garantissent des résultats de laboratoire précis. |

| Catégorie de fonctionnalité | Détails techniques pour PL-CP82 |
|-------------------------------|---|
| Identification du produit | Porte-wafer personnalisé série PL-CP82 |
| Matériau principal | PTFE vierge de haute pureté (Polytétrafluoroéthylène) |
| Compatibilité taille de wafer | Standard 8 pouces (200mm) / Diamètres entièrement personnalisables |
| Type de configuration | Wafer unique (individuel) ou Multi-fentes disponible |
| Méthode de fabrication | Usinage CNC de précision à 100 % (Aucun résidu de moulage) |
| Plage de température | -200°C à +260°C (-328°F à +500°F) |
| Compatibilité chimique | Universelle (HF, HCl, H2SO4, KOH, Acétone, etc.) |
| Rugosité de surface | Personnalisable en fonction des exigences spécifiques de la salle blanche |

| Application | Description | Avantage clé |
|-----------------------------|---|--------------|
| Catégorie de fonctionnalité | Détails techniques pour PL-CP82 | |
| Pas / Profondeur des fentes | Adapté aux paramètres de processus spécifiques du client | |
| Poignée/Interface | Points de préhension robotiques personnalisés ou options de préhension manuelle | |
| Précision dimensionnelle | Contrôle de tolérance de haute précision selon les normes industrielles | |